

## 电流密度对V-4Cr-4Ti合金基体上电沉积W涂层显微结构的影响

李绪亮,张迎春,江凡,王莉莉,刘艳红,孙宁波

北京科技大学材料科学与工程学院, 北京 100083

### EFFECTS OF CURRENT DENSITY ON MICROSTRUCTURE OF W COATING ON V-4Cr-4Ti ALLOY BY ELECTRODEPOSITION

LI Xuliang, ZHANG Yingchun, JIANG Fan, WANG Lili, LIU Yanhong, SUN Ningbo

School of Materials Science and Engineering, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083

[摘要](#)

[图/表](#)

[参考文献](#)

[相关文章 \(15\)](#)

版权所有 © 2008 《金属学报》编辑部

地址: 沈阳市文化路72号, 中国科学院金属研究所(110016)

电话: +86-024-23971286, 传真: +86-024-23843760 E-mail: jsxb@imr.ac.cn

本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持: support@magtech.com.cn